

成都镀膜设备 至成镀膜设备厂家供应 真空磁控溅射镀膜设备厂家

产品名称	成都镀膜设备 至成镀膜设备厂家供应 真空磁控溅射镀膜设备厂家
公司名称	东莞市至成真空科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市万江区流涌尾工业区汾溪路450号
联系电话	13926868291

产品详情

镀膜行业发展的趋势

当今镀膜行业制作方式主要有两种，一种是化学气象沉积，一种是化学镀膜（CVD），一种是物理气象沉积，也就是真空镀膜（PVD）。

化学镀膜是把含有构成薄膜元素的气态反应剂或液态反应所需其他气体引入反应室，在衬底表面发生化学反应生成薄膜的过程。在化学薄膜的过程中，容易产生溶液污染，如果镀层表面杂质多，镀出来的效果不好。

化学镀膜需要的反应温度很高，一般要控制在1000 左右，但很多基体材料是无法受此高温，及时硬质合金，虽然能经受高温，但在化学镀膜制作的环境下由于高温也会造成晶粒粗大，引起脆性相，性能变坏。如果在硬质合金上镀TiN，晶体扩散出来的碳会与溶液发生反应形成脱碳层，该层韧性差，抗弯强度低，造成刀具使用寿命缩短。

真空镀膜机很好的解决了化学镀膜产生的一系列问题。真空镀膜是在真空条件下，采用低电压、大电流的电弧放电技术，利用气体放电技术，利用其他放电是靶材蒸发并使被蒸发物质与气体都发生电离，利用电场的加速作用，使被蒸发物质及反应产物沉积在工件上。

所有镀层材料都是在真空环境下通过等离子体沉积在工件表面，解决了化学镀膜中的溶液污染问题，不会产生有毒或污染物质，镀出来的膜层硬度更高，耐磨性和腐蚀性好，性能更稳定。真空镀膜工艺处理的温度可以控制在150 ~500 以下，适用于多种基体材料，可制备多姿多彩的膜层，镀制硬质合金刀具可使其寿命提高2~10倍。

pvd镀膜设备镀出的膜层出现异常,是什么原因

之前有少数客户会咨询我们，为什么PVD镀膜设备镀出来的膜，偶尔会出现异样的情况，问具体是什么原因。经过我们技术人员上门检查排查，原因各有不同，下面真空小编为大家讲解真空镀膜不良解析。

随着消费水平的提升，人们对产品外观要求也越来越更高，PVD镀膜的应用也越来越广泛。PVD镀膜设备也获得越来越多的制造业厂家认可和喜爱，它的优势也是显而易见的。大家都知道机器，真空镀膜是把金属或者金属氧化物变成气态的分子或原子使其沉积在镀件表面形成镀层的一种技术。和传统的电镀技术相比污染更小、能耗更低，所需的成本较低，装饰效果和金属感都比较强。但是大家也都知道它的缺点，PVD电镀工艺不良率高、生产效率低、膜后不稳定以使颜色稳定性差等，这是整个行业的痛点。随着后期技术不断的发展，环保要求门槛不断提高，传统电镀逐渐将被替代及消费者对产品外观的提高，真空镀膜技术在未来会有更广阔的发展前景。

磁控溅射镀膜设备镀膜优势

磁控溅射镀膜机有很多种类型，有中频的，也有直流的。在生活中应用也是非常的广泛，如：手提电脑、手机壳、电话、无线通讯、试听电子、工具、表壳、手机壳、五金等。它的优势也是非常的凸显。

磁控溅射镀膜设备配置了等离子体处理装置，磁控溅射阴极和电阻蒸发装置等，设备沉积速率快，镀层附着力好，镀层细腻致密，表面光洁度高，且均匀性一致性良好;该机实现镀膜工艺全自动化控制，装载量大，工作可靠，合格率高，生产成本低，绿色环保。该设备主要广泛应用于电脑壳、手机壳、家用电器等行业，可镀制金属膜、合金膜、复合膜层、透明(半透明)膜、不导电膜、EMI电磁屏蔽膜等。

磁控溅射镀膜机将磁控溅射技术和真空蒸发技术结合在同一真空镀膜设备里，既利用磁控溅射阴极辉光放电将靶材原子溅出并部分离子化沉积在基材成膜，同时又可利用在真空中以电阻加热将金属镀料熔融并让其气化再沉积在基材上成膜，增加了设备的用途和灵活性。该设备应用于手机壳等塑料表面金属化，应用于不导电膜和电磁屏蔽膜沉积。